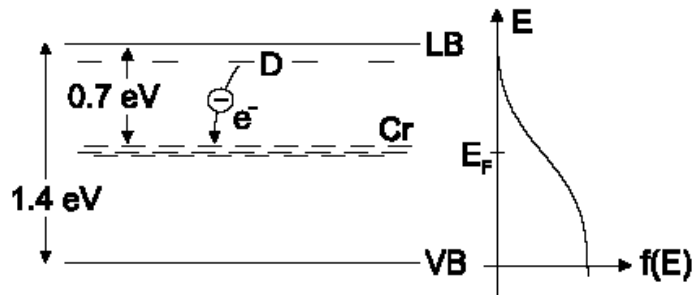


ÜBUNGSBLATT 8

Beispiel 29 (Substrate in der Mikroelektronik):

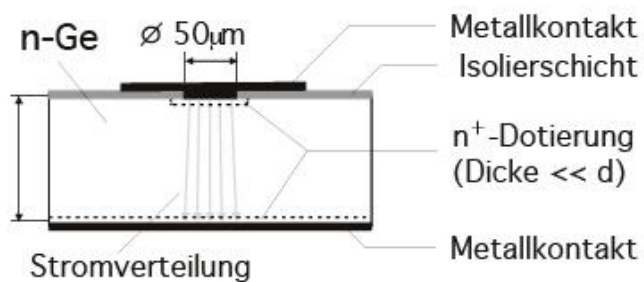
Halbleitersubstrate in der Mikroelektronik sollen eine möglichst geringe Leitfähigkeit haben, um Leckströme zwischen benachbarten Bauelementen zu minimieren. Verschiedene Dotierungen (in GaAs) verändern die spezifische Leitfähigkeit.



- Berechnen sie die spezifische Leitfähigkeit $\sigma = e(\mu_n n + \mu_p p)$ von *reinem* GaAs bei Raumtemperatur ($T=300\text{K}$).
- In der Praxis haben aus der Schmelze gezogene GaAs-Kristalle typisch 10^{14} Störstellen/ cm^3 . Nehmen Sie an, dass es sich dabei um Donatoren (wenige meV unterhalb der Leitungsbandkante) handelt und dass alle Störstellen ionisiert sind. Wie hoch ist dann die spezifische Leitfähigkeit?
- In GaAs bringt man daher Cr als tiefe Akzeptoren ein, um die unbeabsichtigt vorhandenen flachen Donatoren zu kompensieren und das Substrat „semi-isolierend“ zu machen. Dabei wird Cr so hoch gewählt ($\sim 10^{18} \text{ cm}^{-3}$), dass alle Elektronen eingefangen werden. Aus der Ladungsneutralität ergibt sich unter Berücksichtigung der Besetzungsstatistik für die Akzeptoren, dass das Ferminiveau aufgrund der hohen Cr-Dichte in der Bandmitte (0,7 eV unter der Leitungsbandkante) „gepinnt“ wird. Berechnen Sie die spezifische Leitfähigkeit.

Beispiel 30 (Temperatursensor):

Ein Temperatursensor sei aus n-Ge mit einer Dotierung von $N_D=1 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ hergestellt. Der Bandabstand von Ge ist 0.66 eV, N_c sei $1 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, $N_v=6 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$. Bandabstand und Bandgewichte sind näherungsweise temperaturunabhängig. Die Beweglichkeiten bei 300 K sind $\mu_p = 1900 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ und $\mu_n = 3900 \text{ cm}^2/\text{Vs}$.

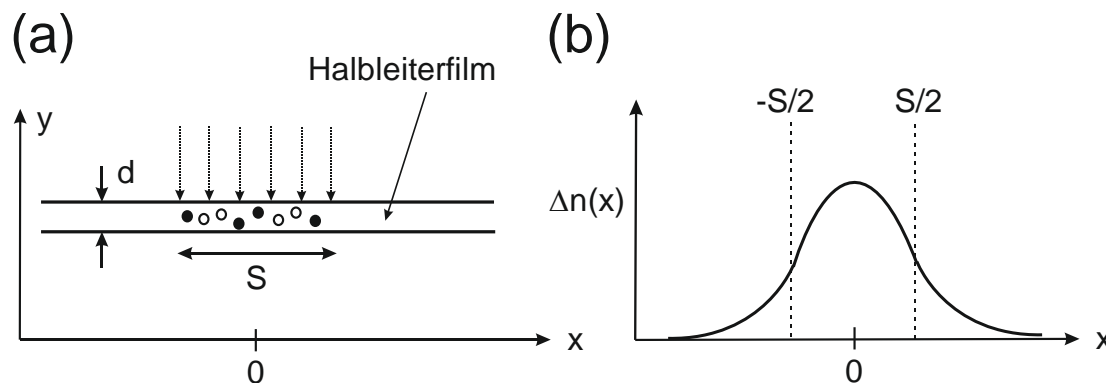


- Berechnen Sie die Ladungsträgerkonzentrationen und die spezifische Leitfähigkeit des n-Ge bei $T = 300 \text{ K}$.
- Wie groß sind die Ladungsträgerkonzentrationen und die spezifische Leitfähigkeit bei $T = 400 \text{ K}$? Nehmen Sie an, die Beweglichkeiten seien proportional zu T^{-2} .
- Berechnen Sie den Widerstand R des Sensors bei 300 K und 400 K. Gehen Sie dazu von einer homogenen Stromverteilung wie oben dargestellt aus.
- Optional: Wie sieht der Widerstand $R(T)$ des Sensors von 300-400 K aus? Wo ist die Empfindlichkeit am größten?

Beispiel 31 (Ladungsträgerkonzentration):

- (a) Leiten Sie aus der Bedingung der Ladungsneutralität und dem Massenwirkungsgesetz einen Ausdruck für die Elektronen- bzw. Löcherkonzentration in einem undotierten und einem n-dotierten Halbleiter her.
- (b) Eine homogene Indiumantimonid (InSb) Probe ist mit $3 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ Selenatomen (Donatoren) dotiert. Die Bandgewichte von InSb bei $T = 300 \text{ K}$ betragen $N_c = 4.2 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ sowie $N_v = 7.3 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$. Der Bandabstand bei $T = 300 \text{ K}$ ist 0.17 eV . Wie groß sind die Elektronen- und Löcherkonzentrationen bei 300 K ?
- (c) Eine Si-Probe ist mit $5 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ Boratomen dotiert. Wie groß ist die Elektronen- und Löcherkonzentration bei $T=300\text{K}$? Wie groß ist die Elektronen- und Löcherkonzentration bei $T=300^\circ\text{C}$?

Beispiel 32 (Diffusion):



In einem dünnen Halbleiterfilm werden auf einer Länge S Ladungsträger injiziert. Die Generationsrate sei $G(x) = G_0$ für $|x| \leq S/2$ und $G(x) = 0$ für $|x| \geq S/2$. Der Film sei so dünn ($d \ll \lambda$), sodass Sie in y -Richtung eine homogene Ladungsträgerverteilung annehmen können (d.h. keine Diffusion in y -Richtung). Aufgrund von lateraler Diffusion stellt sich allerdings in x -Richtung eine Elektronenverteilung $\Delta n(x)$ ein wie sie schematisch in Abbildung (b) dargestellt ist.

- (a) Leiten Sie aus der Kontinuitätsgleichung und aus der Gleichung für die Diffusionsstromdichte eine Differentialgleichung für den Elektronenüberschuss $\Delta n(x)$ her. Die Lebensdauer der Elektronen sei τ_n .
- (b) Lösen Sie die Differentialgleichung in den Gebieten $|x| \leq S/2$ und $|x| \geq S/2$.
- (c) Zeigen Sie, dass man aus den Rand- bzw. Anschlussbedingungen folgenden Ausdruck für die Elektronendichte erhält (L_n ... Diffusionslänge):

$$\Delta n(x) = \begin{cases} G_0 \tau_n \left[1 - \exp\left(-\frac{S}{2L_n}\right) \cosh\left(\frac{x}{L_n}\right) \right] & |x| \leq \frac{S}{2} \\ G_0 \tau_n \sinh\left(\frac{S}{2L_n}\right) \exp\left(-\frac{|x|}{L_n}\right) & |x| \geq \frac{S}{2} \end{cases}$$